

京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点の
利用に係る負担金に関する内規

(平成23年3月23日拠点マネージャー裁定制定)

(趣旨)

第1条 この内規は、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点利用内規（平成23年3月23日拠点マネージャー裁定。以下「利用内規」という。）第11条第2項の規定に基づき、装置等の利用負担金及び実験室等（サテライトラボ（専有部分）及びセミナー室を除く。以下同じ。）の基本料金及び技術代行等における技術料（以下「利用負担金等」という。）並びにサテライトラボ（専有部分）及びセミナー室の利用料金の額等に関し必要な事項を定める。

(利用に係る負担金の額)

第2条 装置等を利用する者は、当該装置等の利用負担金及び当該装置等の利用に係る基本料金の合計額を負担するものとする。

2 技術代行及び技術補助並びに事前講習（以下「技術代行等」という。）を利用する者は、当該技術代行等において使用する装置等の利用負担金及び技術料の合計額を負担するものとする。

3 サテライトラボ（専有部分）又はセミナー室を利用する者は、その利用料金を負担するものとする。

(利用負担金の額)

第3条 装置等の利用負担金の額は、別表第1に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用内規第2条第2項の規定による利用の場合は、別表第1に定める額を2倍した額を装置等の利用負担金とする。

(利用負担金の上限)

第4条 利用を許可されたテーマごとに利用者が負担する装置等の利用負担金の累積額が、別表第2左欄に定める利用者の種別に応じて同表右欄に定める額（以下「負担上限額」という。）を超えた場合、当該利用を許可された期間中は、当該利用者に対し、当該超えた額の負担は求めないものとする。

2 利用者は、利用を許可されたテーマごとに負担上限額をあらかじめ納付しておくことにより、当該利用を許可された期間中は、装置等の利用負担金を都度納付することなく、当該テーマにおいて装置等を利用することができる。この場合において、当該テーマの使用実績に応じた利用負担金の累積額が負担上限額を下回っても、一旦納付された負担上限額との差額は返還しない。

(基本料金の額)

第5条 装置等利用に係る基本料金の額は、別表第3に定める額とする。

(技術代行等における技術料の額)

第6条 技術代行等における技術料の額は、別表第4に定める額とする。

(サテライトラボ及びセミナー室の利用料金の額)

第7条 サテライトラボ（専有部分）又はセミナー室を利用する場合の利用料金の額は、別表第5に定める額とする。

(利用負担金等の割引)

第8条 利用内規第5条第1号及び第2号に掲げる者（以下「1号利用者」という。）については、利用負担金等の額を、別表第1、第3及び第4に定める額の半額とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の半額とするのは、事前講習及び利用内規別表第1の微細構造解析装置群（以下「微細構造解析装置群」という。）利用者の技術補助の技術料の場合に限る。

2 利用内規第5条第3号に掲げる者のうち、文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ事業に則って研究成果を公開することについてあらかじめハブ拠点と合意した者（以下「成果公開利用者」という。）であって、その所属する機関が中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第2条における中小企業者であるもの（以下「2号利用者」という。）については、利用負担金等の額を、別表第1、第3及び第4に定める額の半額とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の半額とするのは、事前講習の技術料の場合に限る。

3 利用内規第5条第3号に掲げる者のうち、成果公開利用者であって、その所属する機関が中小企業基本法第2条における中小企業者ではない企業であるもの（以下「3号利用者」という。）については、利用負担金等の額を、別表第1、第3及び第4に定める額の7割に相当する額とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の7割とするのは、事前講習の技術料の場合に限る。

4 利用内規第5条第3号に掲げる者のうち、成果公開利用者であって、学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施するもの（以下「4号利用者」という。）については、利用負担金等の額を、別表第1、第3及び第4に定める額の半額とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の半額とするのは、事前講習の技術料の場合に限る。

5 利用内規第5条第3号に掲げる者のうち、学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施するものであって、成果公開利用者でないもの（以下「5号利用者」という。）については、利用負担金等の額を、別表第1、第3及び第4に定める額の8割に相当する額とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の8割に相当する額とするのは、事前講習の技術料の場合に限る。

6 利用内規別表第1の微細加工装置群（以下「微細加工装置群」という。）を利用するために、ハブ拠点で準備した標準試料を用いて事前講習を受講する場合の利用負担金の額は、別表第1に定める額（前各項に掲げる者については、前各項の規定により別表第1に定める額から割り引いた後の額）及び別表第4に定めた事前講習の半額とする。

(データ登録者に対する利用負担金等の特別割引)

第9条 前条にかかわらず、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点データ登録内規（令和5年3月〇〇日拠点マネージャー裁定。）第2条第2号のハブ拠点の装置を利用し、かつ当該装置から取得したデータの登録を申請するものの利用負担金等の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 1号利用者は、別表第1、第3及び第4に定める額の3割5分とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の3割5分とするのは、事前講習及び微細構造解析装置群利用者の技術補助の技術料の場合に限る。

(2) 2号利用者は、別表第1、第3及び第4に定める額の3割5分とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の3割5分とするのは、事前講習の技術料の場合に限る。

(3) 3号利用者は、別表第1、第3及び第4に定める額の5割6分に相当する額とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の5割6分に相当する額とするのは、事前講習の技術料の場合に限る。

(4) 4号利用者は、別表第1、第3及び第4に定める額の3割5分とする。ただし、技術料の額を別表第4に定める額の3割5分とするのは、事前講習の技術料の場合に限る。

2 前項の規定により割引後の料金に10円未満の端数が出た場合は、1円単位で四捨五入した額とする。

(キャンセル料の額)

第10条 装置等の利用中止に係るキャンセル料の額は、別表第6に定める額とする。

(新規利用者及び紹介者の利用負担金)

第11条 第3条、第4条、第8条及び第9条の規定にかかわらず、新規利用者及び紹介者の装置等（微細加工装置群の装置等に限る。）の利用負担金に関し必要な事項は、別に定める。

(内規の変更)

第12条 拠点マネージャーは、次の各号に掲げる場合には、利用内規第7条第7項に定める利用責任者（以下「利用責任者」という。）の同意を得ることなくこの内規を変更できるものとする。

(1) この内規の変更が、利用責任者の一般の利益に適合するとき。

(2) この内規の変更が、利用内規第2条の目的及びハブ拠点の利用目的に反せず、かつ、ハブ拠点管理上の必要性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2 前項による内規の変更にあたっては、内規を変更する旨及び変更後の内規の内容並びに変更の効力発生日を、当該効力発生日までに相当な期間においてハブ拠点ホームページに掲示し、又は利用責任者に電子メールで通知するものとする。

(その他)

第13条 この内規に定めるもののほか、利用負担金等及びキャンセル料に関し必要な事

項は、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点要項（平成30年7月31日ナノテクノロジーハブ拠点ユニット長裁定）第3第1項に規定する運営責任者が定める。

附 則

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成23年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月16日から施行する。

附 則

この内規は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成26年8月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

- 1 この内規は、令和元年10月1日から施行する。
- 2 第5条第1項に係る別表第2の規定については、この規程の施行の日の前に利用を許可された期間が終了する場合は、なお従前の例による。また、利用を許可された期間が施行日前後にまたがる場合は、別表第2に定める金額の110分の100に相当する額を基準とし、施行日前の利用については、利用負担金の合計金額の108分の100に相当する額を、施行日以後の利用については、利用負担金の合計金額の110分の100に相当する額をそれぞれ算出し、その累積額が、基準を超えた場合、当該利用を許可された期間中は、当該利用者に対し、それ以降の負担は求めないこととする。

附 則

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 装置等の利用負担金

装置等		利用料	設置場所
装置群	機器名	(一時間当たり)	
A ナノリソグラフィー装置	高速高精度電子ビーム描画装置	90,520円	イエロールーム
	レーザー直接描画装置	24,570円	イエロールーム
	高速マスクレス露光装置	13,970円	イエロールーム
	レジスト塗布装置	2,710円	イエロールーム
	レジスト現像装置	2,710円	イエロールーム
	スプレーコータ	3,450円	イエロールーム
	ウェハスピン洗浄装置	5,040円	イエロールーム
	厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置	5,330円	イエロールーム
	両面マスクアライナー	9,760円	イエロールーム
	露光装置（ステッパー）	36,210円	イエロールーム
	ICP質量分析装置	8,410円	イエロールーム
	紫外線露光装置	1,510円	イエロールーム
	超微細インクジェット描画装置	3,690円	イエロールーム
	有機現像液型レジスト現像装置	3,620円	イエロールーム
	E B 露光装置	3,310円	桂クリーンルーム
	近接効果補正システム	3,140円	クリーンルーム2
	超臨界洗浄乾燥装置	2,070円	イエロールーム
	高压ジェットリフトオフ装置	6,850円	イエロールーム
	ステッパ	32,020円	桂クリーンルーム
	移動マスク紫外線露光装置	14,780円	桂クリーンルーム
	両面マスクアライナ露光装置	2,320円	桂クリーンルーム
	大面積超高精度電子線描画装置	119,480円	加工・評価室
B ナノ材料加工・創製装置	真空蒸着装置	2,130円	加工・評価室
	多元スパッタ装置（仕様A）	13,840円	加工・評価室
	多元スパッタ装置（仕様B）	13,170円	加工・評価室
	電子線蒸着装置	10,860円	クリーンルーム1
	プラズマCVD装置	21,980円	クリーンルーム1
	熱酸化炉	3,210円	クリーンルーム2
	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	12,410円	クリーンルーム2
	ドライエッチング装置	3,100円	クリーンルーム2
	深堀りドライエッチング装置	18,050円	クリーンルーム1
	磁気中性線放電ドライエッチング装置	18,100円	クリーンルーム1
	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	14,490円	クリーンルーム1
	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	7,310円	クリーンルーム2
	紫外線ナノインプリントボンダアライメント装置	15,490円	イエロールーム
	基板接合装置	14,070円	イエロールーム
	集束イオンビーム/走査電子顕微鏡	44,330円	加工・評価室
	赤外フェムト秒レーザ加工装置	12,160円	加工・評価室
	レーザアニール装置	11,530円	加工・評価室
	レーザダイシング装置	23,220円	加工・評価室
	真空マウンター	1,810円	加工・評価室
	紫外線照射装置	800円	加工・評価室
	エキスパンド装置	420円	加工・評価室
	ダイシングソー	2,100円	加工・評価室
	ウェッジワイヤボンダ	910円	加工・評価室BF
	ボールワイヤボンダ	930円	加工・評価室BF
	ダイボンダ	840円	加工・評価室BF
	ナノインプリントシステム	3,690円	イエロールーム
	赤外透過評価検査／非接触厚み測定機	3,480円	イエロールーム
	電子線蒸着装置（2）	1,390円	イエロールーム
	高性能マッフル炉	150円	イエロールーム
	UVオゾンクリーナー・キュア装置	1,910円	サテライトラボ
	アクアプラズマクリーナー	3,100円	クリーンルーム2
	誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置	19,530円	クリーンルーム1
	赤外線ランプ加熱装置	1,170円	加工・評価室
	パリレン成膜装置	1,230円	桂クリーンルーム
	ICP-RIE装置	1,720円	桂クリーンルーム
	簡易RIE装置	1,110円	桂クリーンルーム
	ウェハ接合装置	15,610円	桂クリーンルーム
	ナノインプリント装置	610円	桂クリーンルーム
	ダイシング装置	1,970円	桂クリーンルーム
C ナノ材料分析・評価装置	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	16,530円	加工・評価室
	分析走査電子顕微鏡	23,020円	加工・評価室
	X線回折装置	9,310円	加工・評価室BF
	触針式段差計 1	1,580円	加工・評価室
	触針式段差計 2	1,580円	クリーンルーム2
	マイクロシステムアナライザ	9,700円	加工・評価室
	高速液中原子間力顕微鏡	8,790円	加工・評価室BF
	走査型プローブ顕微鏡システム	8,000円	加工・評価室BF
	光ピンセット	6,710円	加工・評価室
	共焦点レーザー走査型顕微鏡	8,560円	加工・評価室
	全反射励起蛍光イメージングシステム	7,000円	加工・評価室
	長時間撮影蛍光イメージングシステム	5,320円	加工・評価室
	3D測定レーザー顕微鏡	3,440円	加工・評価室
	ゼータ電位・粒径測定システム	3,680円	加工・評価室
	分光エリブソメーター	5,670円	加工・評価室
	ダイナミック光散乱光度計	4,890円	加工・評価室
	パワーデバイスアナライザ	2,740円	クリーンルーム2
	（プローバ）	2,160円	加工・評価室
	インピーダンスアナライザ	1,130円	加工・評価室BF
	（真空プローバ）	8,460円	加工・評価室BF
	光ヘテロダイン微小振動測定装置	3,620円	加工・評価室BF
	超微小材料機械変形評価装置	3,620円	加工・評価室BF
	卓上顕微鏡 (SEM)	1,340円	クリーンルーム1
	セルテストシステム	3,590円	加工・評価室BF
	高周波伝送特性測定装置	1,200円	加工・評価室
	（RFプローブキット）	490円	加工・評価室
	（ネットワークアナライザ）	1,220円	加工・評価室
	（半導体パラメータアナライザ）	1,200円	加工・評価室
	強誘電体特性評価システム	2,460円	加工・評価室
	接触式シート抵抗測定器	1,060円	加工・評価室
	ウェハプロファイラ	18,620円	クリーンルーム2
	光干渉膜厚計	840円	桂クリーンルーム
D ナノ微細構造解析	極低温超高分解能透過電子顕微鏡	22,560円	極低温電子顕微鏡棟9－1室
	球面収差補正透過電子顕微鏡	17,100円	極低温電子顕微鏡棟9－2室
	モノクロメータ搭載低加速原子分解能分析電子顕微鏡	25,680円	超高分解能分光型電子顕微鏡棟3号室
	集束イオンビーム装置	6,960円	超高分解能分光型電子顕微鏡棟6号室
	精密イオン研磨装置	1,540円	超高分解能分光型電子顕微鏡棟6号室
	ミクロトーム	1,540円	極低温電子顕微鏡棟9－2室
	ディンプリング装置	620円	共同研究棟CL-203室

備 考

1. 上記表中の利用料は、1時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これに当該機器利用時間数を乗じた金額を利用負担金とする。
2. 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用負担金を算出するものとする。
3. 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額を利用負担金とする。
4. 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、別表第3の基本料金を負担しなければならない。

別表第2 利用負担金の上限額

利用者種別	利用料（1テーマ当たり）
第8条第1項の1号利用者又は同条第4項の4号利用者であって、データ登録者であるもの	400万円
第8条第1項の1号利用者又は同条第4項の4号利用者であって、データ登録者でないもの	600万円
上記以外の者	1,700万円

備 考

- 1 上記表中の利用料は、1テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む。）である。

別表第3 装置等利用に係る基本料金

利用料（1時間当たり）
1,500円

備 考

- 1 上記表中の利用料は、1時間当たりの装置等利用に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これに利用時間数を乗じた金額を基本料金とする。

別表第4 技術代行等における技術料

区分	1時間当たり
技術補助	8,800円
技術代行	8,800円
事前講習	8,800円

備考

- 1 上記表中の料金は、1時間の技術代行等に係る金額（消費税相当額を含む。）であり、これに利用時間数を乗じた金額を技術料とする。
- 2 1時間未満の技術代行等及び1時間を超える技術代行等に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の技術代行等として、算出するものとする。
- 3 技術代行の技術料には装置等利用の代行料金だけではなく、事前技術検討、事後データ処理又はまたは事後技術検討等の料金も含む。

別表第5 サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金

実験室等	利用料	
	1日当たり	1時間当たり
サテライトラボ（専有部分）	168円	21円
セミナー室		

備 考

- 1 上記表中の料金は、実験室等の床面積1平方メートルあたりの1日又は1時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む。）であり、これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利

用時間数を乗じた金額とする。

- 2 1 時間未満の実験室等利用及び 1 時間を超える実験室等利用に係る 1 時間未満の端数については、それぞれ 1 時間の実験室等利用として、利用料金を算出するものとする。
- 3 複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とする。

別表第 6 装置等の利用中止に伴うキャンセル料

区 分	キャンセル料
装置利用日の 6 営業日前から 2 2 営業日前まで	利用負担金の額の 2 5 %
装置利用日の 4 営業日前から 5 営業日前まで	利用負担金の額の 5 0 %
装置利用日当日から 3 営業日前まで	利用負担金の額の 1 0 0 %

備 考

- 1 利用負担金の額とは、利用を許可された装置等の利用負担金の額であり、第 3 条、第 5 条、第 7 条、第 8 条及び第 9 条に基づき算出した額とする。
- 2 営業日とは、利用内規第 3 条に規定する利用日とする。
- 3 キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとする。